

1^{er} Workshop Réseau des Acteurs Français de l'ALD

RAFALD



16 -17 -18 Novembre 2015

Minatec et Campus Est, Grenoble, France

Ce premier **Workshop**, dédié à la technologie **ALD** (Atomic Layer Deposition), a pour but de fédérer une communauté française, industrielle et académique, afin d'initier la **création** d'un **réseau national**.

Domaines Microélectronique, Energie, Textile, Biologie, Nanotechnologies...

Public Chercheurs, Enseignants, Ingénieurs, Doctorants, Techniciens, Etudiants

Soumission des résumés: date limite 1^{er} Juillet 2015

www.rafald.org

PROGRAMME

Lundi 16

MINATEC CAMPUS	13.00 - 14.00
	14.00 - 14.30
	14.30 - 17.00
	17.00 - 19.00

Accueil
Introduction
Tutoriels, Historique et principes de base de l'ALD (F. Donsanti),
Précureurs (S. Danièle), Equipements (J. Kools),
Applications actuelles et émergentes (C. Vallée)
Session Posters

Mardi 17

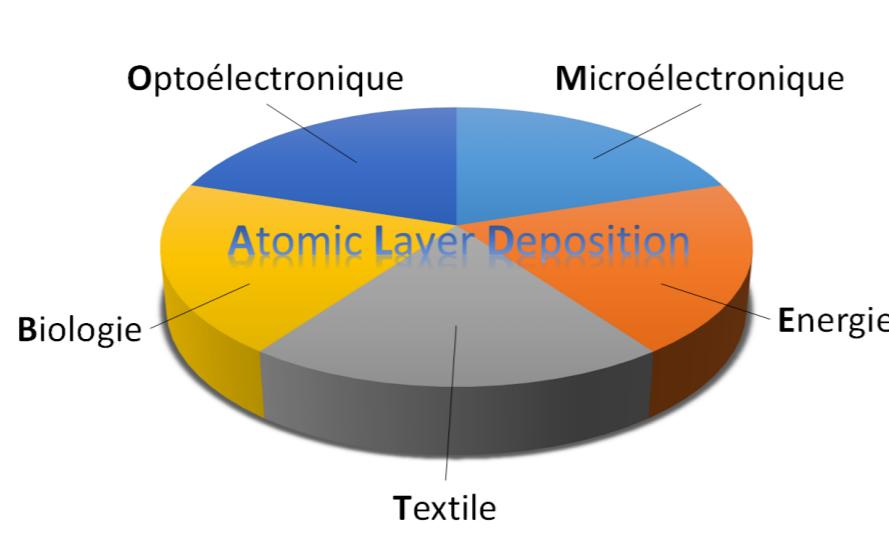
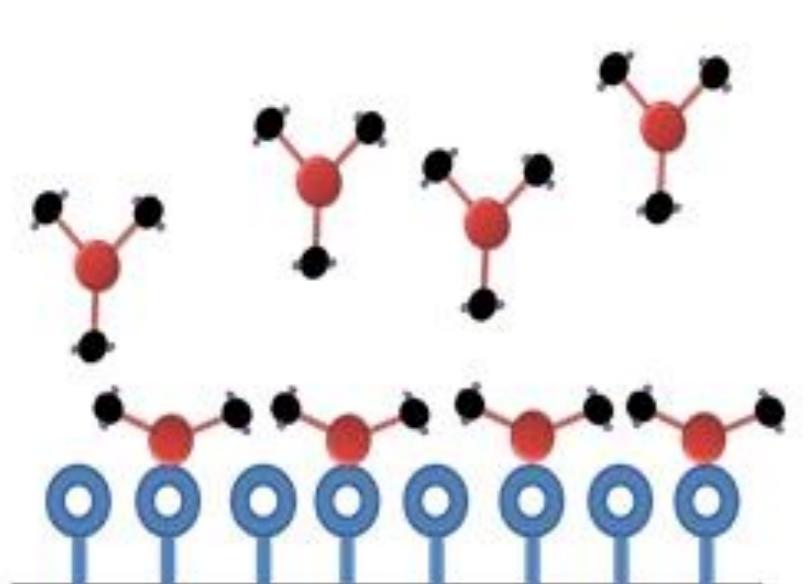
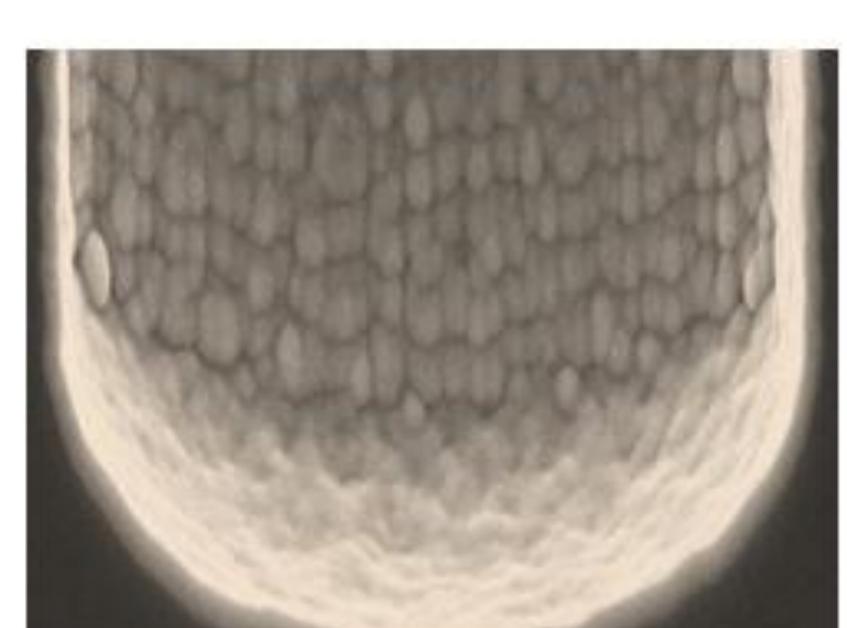
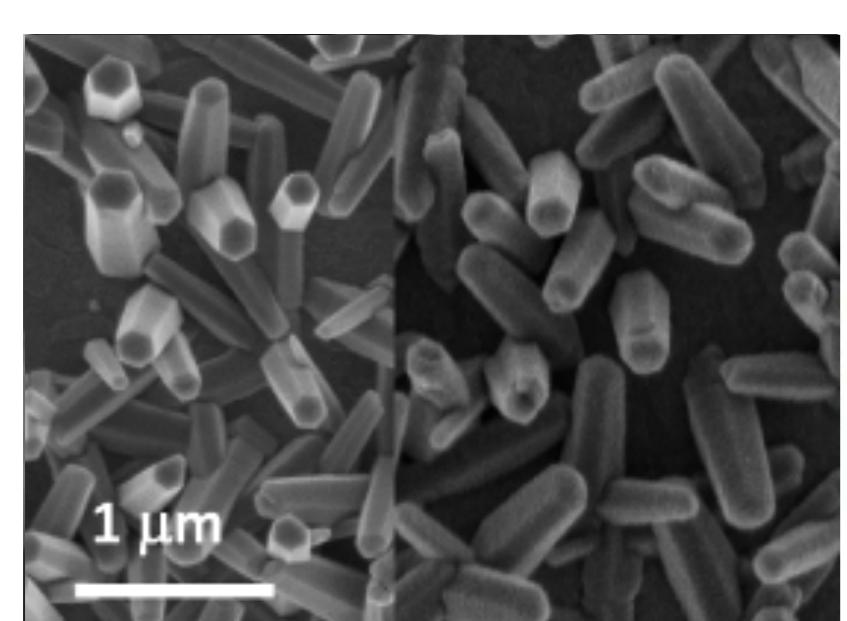
MINATEC CAMPUS	08.00 - 12.30
	14.30 - 19.00
	20.00 - 23.00

Simulations et Précurseurs
Croissance, Caractérisations et Applications émergentes
Dîner de Gala

Mercredi 18

CAMPUS EST	09.00 - 12.30
	14.00 - 16.00

Présentation du Labex CEMAM, Equipements ALD
Construction du Réseau RAFALD, Réseau EU COST HERALD



Frais d'inscription : 100 € / 60 € (doctorants)

Contact: rafael@simap.grenoble-inp.fr

COMITE SCIENTIFIQUE

N. Bahlawane (Lippman) - S. Bellardie (Air Product)
D. Blanc-Pelissier (INL) - N. Blasco (Air Liquide)
M. Cassir (Chimie Tech Paris) - S. Daniele (IRCELYON)
J.-M. Decams (Annealsys) - F. Donsanti (EDF)
A. Esteve (LAAS) - M. Gros-Jean (STMicroelectronics)
J. Kools (Encapsulix) - F. Neuilly (IEMN)
A.-S. Ozanne (INES) - L. Santinacci (CINAM)
C. Valhas (CIRIMAT) - J. Vitiello (Altatech)

COMITE LOCAL

E. Blanquet (SIMaP) - R. Boichot (SIMaP)
L. Cagnon (Institut NEEL) - R. Gassilloud (CEA/Leti)
C. Jiménez (LMGP) - T. Maindron (CEA/Leti)
A. Mantoux (SIMaP) - D. Muñoz-Rojas (LMGP)
C. Vallée (LTM)

RAFALD
Réseau des Acteurs Français de l'ALD